PRODUCTION OF PURIFIED HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION

Publication number: JP2000302419 (A)

Publication date: 2000-10-31

Inventor(s): NAMIKAWA YOSHIJI; KOMAKI TAKESHI; INAGAKI SUSUMU; NISHIZAWA

CHIHARU

Applicant(s): MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO

- international: C01B15/023; C01B15/00; (IPC1-7): C01B15/023 - European:

- European

Application number: JP19990112855 19990420
Priority number(s): JP19990112855 19990420

Abstract of JP 2000302419 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a highly pure hydrogen peroxide aqueous solution by evaporating a hydrogen peroxide aqueous solution with an evaporator, separating the vapor with a gas-liquid separator, charging the vapor into a partial condenser preferably made from zirconium, extracting the purified hydrogen peroxide aqueous solution, and then supplying the concentrated vapor into a rectifier. SOLUTION: A crude hydrogen peroxide aqueous solution contains hydrogen peroxide in a concentration of 15 to 40 wt.%, and further contains organic impurities, iron ions and aluminum ion caused by the materials of installations, and further silicon components and so on caused by processes. The crude hydrogen peroxide aqueous solution is charged into an evaporator 12 from a line 11, and the produced gasliquid mixture is introduced from the evaporator into a gas-liquid separator 12 through a line 11. The hydrogen peroxide aqueous solution separated with a gas-liquid separator 14 is extracted through a line 16. In the partial condenser 17, a heat exchanger, such as a multi-pipe cylindrical heat exchanger. made from zirconium is used in a portion which is brought into contact with the vapor. The liquid 18 condensed with the partial condenser 17 is extracted as a highly pure hydrogen peroxide aqueous solution, and the residual vapor is introduced into a rectifier 21 through a line 19.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-302419 (P2000-302419A)

(43)公開日 平成12年10月31日(2000, 10, 31)

(51) Int.Cl.7

裁別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C 0 1 B 15/023

C 0 1 B 15/023

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(71) 出題人 000004466 三菱瓦斯化学株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 (72)発明者 南川 好次

三重県四日市市日永東2丁目4番16号 三 菱瓦斯化学株式会社四日市工場内

(72) 発明者 小牧 武

三重県四日市市日永東2丁目4番16号 三 菱瓦斯化学株式会社四日市工場内

(72) 発明者 稀垣 晋

三重県四日市市日永東2丁目4番16号 三

菱瓦斯化学株式会社四日市工場内

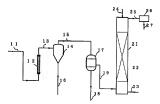
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 精製過酸化水素水溶液の製造方法

(57)【要約】

【課題】 高純度の過酸化水素水溶液の製造方法を提供 する。

【解決手段】 過酸化水素水溶液を蒸発器12で蒸発さ せ、気液分離器14で蒸気を分離し、該蒸気を分縮器1 7に供給し、精製過酸化水素水溶液を抜き出し、さらに 分縮された蒸気を精留塔21に供給する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 過酸化水素水溶液を蒸発器12で蒸発さ セ、気液分解器14で蒸気を分離し、該蒸気を分離器1 7に供給し、精製過酸化水素水溶液を抜き出し、さらに 分縮された素気を特留塔21に供給することを特徴とす る精製過酸化水素水溶液を製造方法。

【請求項2】 分締器の材質がジルコニウムである請求 項1記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アントラキノン法 による通骸化水素の製造方法に関する。本発明による精 製造酸化水素水溶液は高純度が要求される電子工業用と して利用される。

[0002]

【従来の技術】過酸化水素は、工業的にはアントラキノン法により製造されている。ここで得られた相遇酸化水 素水溶液は温酸化水素を15~40重量%を有している が、通常工業的に使用される過酸化水素の濃度は30~ 70重量%であるので相過酸化水素はさらに濃縮される。

[0003] 温酸化水素は、近年、半導体やアリント配線板などの電子工業分野に於ける利用が増大し、ためたデストである。 作って、極めて高純度の治臓化水素水溶液が更まされるようになり、粗過酸化水素の精留濃縮によって得られる製品も「水純物の極めて少ない高純度の品質が要求されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来 技術における上記したような課題を解決し、高純度の過 酸化水素水溶液を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 について銀意検討を行った結果、過酸化水業水溶液を材 質がジルコニウムである分離器により分離することによ り、高純度の過酸化水業が得られることを見いだし本発 明に到達した。

[0006] 即ち、本発明は、過酸化水素水溶液を蒸発 着12で蒸発させ、気能分離器14で蒸気を分離し、該 蒸気を分離37に供給し、排製過酸化水素水を検き出 し、さらに分縮された蒸気を精留塔21に供給すること を特徴とする精製過酸化水素水溶液の製造方法に関する ものである。

[0007]

【発明の実験の影態】本発明の粗過酸化水素水溶液は、 適酸化水素を15~40重量%含有し、有機不続物、速 置材質に起因する鉄やアルミニウムイオン、及びアロセ ス工程上に起因するケイ素成分等を含んでいる。又、ビ ロリン酸磁等の安定剤単娘あるいは混合したものを含ん でいる。 【0008】本駅明をフローダイアグラム(図1)を用いて詳述する。 組造酸化水素水溶液は11のラインよりま発発12を出た気液は、ライン13を通って気流分離器14に薄かれる。過酸化水素の蒸馏は、分解を少なくし安全性を考え通常拠圧下で行われる。 蒸発器の旧りすなわち、気流分離器入り口の温度は、40~90℃、好ましくは60~80℃あり、圧力は、50~200torr、好ましくは60~150torrであり、ほかいている。

【0009】気液分離器14では、揮発性不純物、過酸化水素、木からなる素気上非彈発性不純物を含み蒸気側 組成と平衡にある過酸化水素水溶液に分離される。気液分離器14で分離された。気液分離器7に導かれる。気液分離器7に等かが能させることが 野ましい。気液分離器74で分離させることが 変ました。気液分離器74で分離された過酸化水素水溶液はライン16から抜き出きれる。

【0010】気液分離器としては、サイクロン方式が構造上シブルであり好ましく、さらには、2段又は3段以上の多段サイクロン方式が、有機物を多く含有した砂炉が高まった過酸化水素に対しても高性能の分離効率が得られる事からより好ましい。サイクロンの材質は、アルミコウムやステンレスが使用できるが過酸化水素の分解を少なく抑えるためには、アルミコウムまたはアルミコウム合金が好ましい。

【0012】分縮器17で分縮した液18は、高純度な 過酸化水素水として抜き出きれ、残りの深気はライン1 9を経て精留塔に導かれる。分縮により得られる過酸化 水素の濃度、採取量は、分縮器内蒸気の圧力、温度をコ ントロールすることにより得ることが出来る。分縮器の 温度は、40~90℃、好ましくは60~80℃であ り、圧力は50~200 torr、好ましくは60~1 50 torrである。

【0013】精留幣21は、アルミニウム材質で構成され、ラッシヒリング、インターロックスサドル、カスケードリングなどを充填して用いる方式が安価であり、広く採用されている。精留除の場底は、40~90℃、好ましくは60~80℃であり、圧力は50~200セッド、好ましくは60~100セッドである。「毎頃の圧力は、30~100セッド、 好ましくは40~80セッドである。

[0014]

【実施例】次に実施例によって本発明を具体的に説明する.

【0015】実施例

図1の実験室用試験装置を用いて高純度な過酸化水素の 業留精製を行った。サイクロン、サイクロンから精留塔 に至る配管、精留塔の過酸化水素と接触する部分の材質 には、A1070のアルミ材質を使用した。サイクロン の大きさはDc=40mmのPerry's Hand

Book記載の標準サイクロンであって、サイクロンから精留塔のラインの配管は内径20mmである。 【0016】分縮器17は、蒸気との接触部が輸送ルコ

ニウム (ASTM R60702) よりなるコイル型熱交換器で、 6 mm φ × 1 2 0 0 m m l コイルに冷却水の通液量を調整 し分離を行うものである。精留塔21は塔径50mmで、1/4Bの磁製インターロックスサドル充填材を500mmの高さ充填したものである。

【0017】本蒸留装置において、過酸化水素32重量%、蒸発張分35ppm、安定剤としてビロリン酸ソーグ10水塩を5ppm及びオルトリン酸10ppmを含む租遇酸化水素水溶液を1、200g/hrの流量で蒸発器12に供給して濃縮し、サイクロンの下のライン16より過酸化水素濃度が64重量%の分解液354g/hrと分解器下部18から過酸化水素濃度56重量%の高端度品149g/hrを得た。

【0018】主な運転条件を下記に示す。

サイクロン出口:温度71℃、圧力109torr 分縮器内 :温度63℃、圧力 90torr 還流水:130g/hr

粗原料過酸化水素の成分

A1 :120 ppb (原子吸光により分析) Fе 3 ppb (原子吸光により分析) 7. r 1 ppb以下 (原子吸光により分析) Si : 10 ppb (原子吸光により分析) Νa : 450 daa (原子吸光により分析) PO4 : 10.5ppm (イオンクロマトにより分析)

[0019]

得られた高純度分縮液の成分

A 1 : 1 daa (原子吸光により分析) Re. 0.5ppb (原子吸光により分析) 7. r ppb (原子吸光により分析) Si : 0.2ppb以下 (原子吸光により累積濃縮分析) Na 0. 9ppb (原子吸光により分析) PO4 : 20 ppb (イオンクロマトにより分析)

【0020】比較例

分縮器を取り付けずに行った以内は、実施例2と同様の 条件の蒸留装置を用いた。粗原料油酸化水素は実施例と 同じものを使用した。粗通酸化水素水溶液を1,200 g/hrの流量で蒸発器に供給して濾縮し、サイクロン の下のラインより過酸化水素濃度が62重量%の分離液 406g/hrと精留塔塔底から過酸化水素濃度54重 量%の濃縮液240g/hrを得た。主な運転条件を下 記に示す。

器に供給して濃縮し、サイクロン 【0021】 サイクロン出口:71℃、圧力は109torr

還流水: 300g/hr(Si濃度0. 1ppb以下)

得られた精留塔濃縮液の成分

Al : 135ppb (原子吸光により分析)
Fe : 1ppb (原子吸光により分析)
Zr : 1ppb以下 (原子吸光により分析)
Si : 12ppb (原子吸光により分析)
Na : 3ppb (原子吸光により分析)
PO4 : 18ppb (イオンクロマト分析)

[0022]

【発明の効果】本発明により、高純度の過酸化水素水溶液をシンプルな構造の設備により得ることが出来る。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の過酸化水素の蒸留分縮精製装置

【符号の説明】 12: 蒸発器

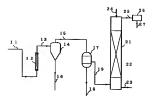
14:気液分離器 17:分縮器

21:精留塔

26: コンデンサー

24:還流水

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 西沢 千春 三重県四日市市日永東2丁目4番16号 三 菱瓦斯化学株式会社四日市工場内